

課題番号 : F-15-RO-0043  
利用形態 : 技術相談  
利用課題名(日本語) : シリコン窒化膜のプラズマ中表面計測についての相談  
Program Title (English) : Consultation of In-situ surface measurement of silicon nitride deposition  
利用者名(日本語) : 岩尾俊彦, 石橋清隆  
Username (English) : T. Iwao, K.Ishibashi  
所属名(日本語) : 東京エレクトロン株式会社  
Affiliation (English) : Tokyo Electron Limited

## 1. 概要(Summary)

横山新 教授にシリコン窒化膜堆積での成膜反応器中での膜表面状態計測技術における技術相談を受けて頂いた。

日時:平成 28 年 3 月 3 日 13:00-15:00

主には横山先生の過去のシリコン窒化膜堆積技術の研究論文、学位論文における計測機器構成、取得データ、考察の情報についてご教示いただいた。

## 2. 実験(Experimental)

なし。

## 3. 結果と考察(Results and Discussion)

なし。

## 4. その他・特記事項(Others)

なし。

## 5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

## 6. 関連特許(Patent)

なし。